

Анализ влияния нелокальности на характеристики ближнего поля слоистой частицы на подложке

© Ю.А. Еремин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991 Москва, Россия

e-mail: eremin@cs.msu.ru

Поступила в редакцию 28.04.2020 г.

В окончательной редакции 28.04.2020 г.

Принята к публикации 29.05.2020 г.

Рассмотрена задача дифракции поля электромагнитной плоской волны на слоистой наночастице с металлическим плазмонным слоем, расположенной на поверхности прозрачной подложки. На основе метода дискретных источников исследовано влияние пространственной нелокальности в металле на интенсивность ближнего поля и сечение поглощения. Рассмотрены случаи возбуждения частицы как распространяющейся, так и неизлучающей волной. Показано, что подложка оказывает более существенное влияние на оптические характеристики ближнего поля, чем на интенсивность в дальней зоне. Установлено, что учет эффекта нелокальности в металле приводит к существенному снижению амплитуды плазмонного резонанса при небольшом сдвиге в коротковолновую область.

Ключевые слова: метод дискретных источников, плазмонный резонанс, слоистая наночастица.

DOI: 10.21883/OS.2020.09.49881.141-20

Введение

Квантовая наноплазмоника привлекает все больший интерес у исследователей во многих странах. Как известно, поверхностные плазмоны позволяют концентрировать электромагнитные поля в субнанометровых объемах, значительно превышая классический предел оптической дифракции. Эта область плазмоники интенсивно развивается благодаря совершенствованию технологий синтеза наноразмерных структур, которые ведут к миниатюризации элементов фотонных схем. Последнее обстоятельство создает условия для их использования в многочисленных практических приложениях [1].

За последние десятилетия использование слоистых наночастиц приобрело огромную популярность благодаря возможности манипулирования материалами и размерами как ядра, так оболочки для управления их плазмонными свойствами. Это обстоятельство выгодно отличает их от однородных частиц. Благодаря впечатляющему прогрессу в материаловедении слоистые наночастицы теперь могут быть синтезированы с улучшенными физико-химическими свойствами, четко определенными размерами, формой и составом [2]. Используя их способность в сверхвысоком усилении поля и концентрации субволнового поля, стало возможным широкое разнообразие применений во многих областях промышленного, клинического, биологического, экологического и пищевого анализа [3,4]. Особый интерес в наноплазмонике вызывает проблема разработки и реализации плазмонного нанолазера. Плазмонные нанолазеры, основанные на использовании слоистых резонаторов, имеют преимущества наноразмера, низкого энергетического порога и супермалого времени отклика [5].

В целом ряде приложений, упомянутых выше, возникает необходимость в исследовании оптических свойств наночастиц, расположенных на диэлектрической подложке. В этом случае весьма важно строго учитывать взаимодействие между частицей и поверхностью подложки. Эти обстоятельства возникают как при попытках обнаружения и определения структуры привнесенных частиц, так и решении проблем синтеза слоистых структур для получения требуемых спектральных свойств [6,7]. При сокращении размера металлических элементов до десятка нанометров электрон-электронные взаимодействия в наноструктурах должны учитываться на другом уровне. Дело в том, что когда характерный размер металлических наночастиц становится сравнимым с длиной волны Ферми электронов в этом металле (~ 5 nm для золота и серебра), возникает так называемая пространственная нелокальность металла. В этом случае классической системы уравнений Максвелла оказывается недостаточно для точного описания электромагнитных свойств плазмонного металла [1].

Существуют различные подходы к описанию возникающего эффекта нелокальности (ЭН), начиная с полной квантово-механической модели, в рамках которой моделируется поведение каждого электрона наноструктуры на основе уравнения Шредингера. Она хорошо подходит для объяснения экспериментальных результатов, но применима лишь к плазмонным частицам диаметром всего в несколько нанометров [8]. В настоящее время при исследовании наночастиц используются подходы, которые учитывают возникающие квантовые эффекты, но позволяют описать их в рамках электромагнитной теории Максвелла. Одним из таких полуклассических подходов, учитывающих ЭН в металлах, является гид-

родинамическая модель Друде [9,10]. Она позволяет учитывать возникающие в металле продольные поля, но требует корректировки квантовых параметров металла при рассмотрении однородных частиц, форма которых отличается от сферической [11]. Следующая модель, свободная от этого ограничения, получила название обобщенного нелокального оптического отклика (ОНО) [12]. В рамках ОНО учитывается диффузия электронов в металле в рамках гидродинамической теории. Это обстоятельство дает возможность исследовать как однородные несферические частицы, так и их кластеры. Модель ОНО оказалась подходящим инструментом также для исследования оптических свойств сферических слоистых частиц в свободном пространстве [13]. Теория ОНО позволяет учитывать как возникающие внутри металла продольные поля, так и дополнительные граничные условия на границах раздела между металлом и диэлектриком [14].

Мы используем модель ОНО в рамках метода дискретных источников (МДИ) [15]. Метод дискретных источников — строгий численно-аналитический поверхностно ориентированный метод. Он основан на представлении полей в виде конечной линейной комбинации распределенных мультиполей низшего порядка [16], удовлетворяющих полуклассическим уравнениям Максвелла, включая продольные поля, внутри металлической оболочки. Для представления рассеянных полей вне частицы используется тензор Грина полупространства [17]. Таким образом, представления полей во всех областях удовлетворяют уравнениям Максвелла, условиям бесконечности и условиям сопряжения на бесконечной поверхности призмы. Соответствующие амплитуды дискретных источников определяются из условий сопряжения, поставленных на поверхностях слоистой частицы, включая дополнительные граничные условия. Исключительная особенность МДИ состоит в том, что он позволяет оценить реальную погрешность полученного решения посредством вычисления невязки полей на поверхностях слоев. Данное обстоятельство дает возможность вычислять ближние поля с гарантированной точностью, что особенно существенно при анализе усиления интенсивности вблизи частицы или сечения поглощения. Все эти моменты позволили использовать МДИ для анализа плазмонных наноструктур с учетом эффекта нелокальности в рамках модели ОНО [18,19].

Постановка граничной задачи дифракции, модель ОНО

Пусть все пространство \mathbb{R}^3 разделено на два полупространства: вмещающая среда — $D_0 : (z > 0)$ и диэлектрическая подложка — $D_1 : (z < 0)$. Обозначим $\Sigma : (z = 0)$ плоскую границу раздела. Пусть сферическая слоистая частица целиком располагается в верхнем полупространстве D_0 . Внутреннее диэлектрическое ядро частицы будем обозначать как D_i , а область металлической оболочки — как D_s . Соответствующие сферические поверхности обозначим как $\partial D_{i,s}$. Все среды

предполагаются немагнитными, а их диэлектрические проницаемости обозначим $\varepsilon_\nu, \nu = 0, 1, i, s$.

Суть ЭН заключается в том, что связь между смещением $\mathbf{D}(M)$ и напряженностью электрического поля $\mathbf{E}(M)$ становится нелокальной, т.е. соотношение $\mathbf{D}(M) = \varepsilon(M)\mathbf{E}(M)$ заменяется на

$$\mathbf{D}(M) = \int \varepsilon(M - M')\mathbf{E}(M')dM',$$

которое переходит в локальное в случае $\varepsilon(M - M') = \delta(M - M')$ [14]. Одним из проявлений ЭН является появление внутри металла продольных электромагнитных полей. В этом случае внутреннее электрическое поле \mathbf{E} перестает быть чисто поперечным ($\text{div}\mathbf{E}^T = 0$) за счет формирования объемного заряда, и для адекватного описания происходящих процессов возникает необходимость привлечения дополнительно продольных полей ($\text{rot}\mathbf{E}^L = 0$) [20]. Для учета нелокальности используется гидродинамическая теория Друде и ее обобщение — модель ОНО [12]. В рамках теории ОНО проводится обобщение закона Ома для тока проводимости внутри металла, т.е. осуществляется переход следующего вида:

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E} \Rightarrow \xi^2\text{grad}(\text{div}\mathbf{J}) + \mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}, \quad (1)$$

где σ — проводимость металла, ξ — параметр нелокальности [14]. В результате изменяется соответствующее уравнение системы Максвелла для магнитного поля. В силу изложенных обстоятельств внутри плазмонного металла происходит расщепление электрического поля на поперечное и продольное: $\mathbf{E}_s = \mathbf{E}_s^T + \mathbf{E}_s^L, \text{div}\mathbf{E}_s^T = 0, \text{rot}\mathbf{E}_s^L = 0$. Можно показать [21], что эти поля внутри оболочки D_s удовлетворяют уравнениям Гельмгольца:

$$\Delta\mathbf{E}^T(M) + k_T^2\mathbf{E}^T(M) = 0, \quad (2)$$

$$\Delta\mathbf{E}^L(M) + k_L^2\mathbf{E}^L(M) = 0. \quad (3)$$

Здесь $k_T^2 = k^2\varepsilon_s, k_L^2 = \varepsilon_s/\xi$ — поперечное и продольное новые числа.

Перейдем к формулировке математической постановки граничной задачи рассеяния для системы Максвелла с учетом ОНО. Обозначим $\{\mathbf{E}^0, \mathbf{H}^0\}$ поле плоской электромагнитной волны линейной поляризации, распространяющейся из верхнего полупространства в полуплоскости $\varphi = \pi$ под углом $\pi - \theta_0$ относительно нормали к подложке, совпадающей с осью Oz . Тогда постановка граничной задачи рассеяния с учетом ЭН может быть записана в следующем виде:

$$\text{rot}\mathbf{H}_\xi = jk\varepsilon_\xi\mathbf{E}_\xi; \text{rot}\mathbf{E}_\xi = -jk\mathbf{H}_\xi \text{ в области } D_\xi,$$

$$\xi = 0, 1, i,$$

$$\text{rot}\mathbf{H}_s = jk(\varepsilon_s + \xi^2\text{grad}\text{div})\mathbf{E}_s(M); \text{rot}\mathbf{E}_s = -jk\mathbf{H}_s \text{ в области } D_s,$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{n}_i \times (\mathbf{E}_i(P) - \mathbf{E}_s(P)) &= 0, \\
\mathbf{n}_i \times (\mathbf{H}_i(P) - \mathbf{H}_s(P)) &= 0, \quad P \in \partial D_i; \\
\varepsilon_i \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{E}_i(P) &= \varepsilon_L \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{E}_s(P) \\
\mathbf{e}_z \times (\mathbf{E}_0(Q) - \mathbf{E}_1(Q)) &= 0, \\
\mathbf{e}_z \times (\mathbf{H}_0(Q) - \mathbf{H}_1(Q)) &= 0, \quad Q \in \Sigma. \\
\mathbf{n}_i \times (\mathbf{E}_s(P) - \mathbf{E}_0^s(P)) &= \mathbf{n}_s \times \mathbf{E}_0^0(P), \\
\mathbf{n}_i \times (\mathbf{H}_s(P) - \mathbf{H}_0^s(P)) &= \mathbf{n}_s \times \mathbf{H}_0^0(P), \quad P \in \partial D_s; \\
\varepsilon_L \mathbf{n}_s \cdot \mathbf{E}_s(P) &= \varepsilon_0 \mathbf{n}_s \cdot (\mathbf{E}_0^0(P) + \mathbf{E}_0^s(P)) \\
\lim_{r \rightarrow \infty} r \cdot \left(\mathbf{H}_0^s \times \frac{\mathbf{r}}{r} - \sqrt{\varepsilon_0} \mathbf{E}_0^s \right) &= 0, \\
r = |M| \rightarrow \infty, \quad \xi = 0, 1, \quad z \neq 0; \\
\max(|\mathbf{H}_0^s|, |\mathbf{E}_0^s|) &= O(\rho^{-1/2}), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\
\rho \rightarrow \infty, \quad z = \pm 0. & \quad (4)
\end{aligned}$$

Здесь $\{\mathbf{E}_\xi, \mathbf{H}_\xi\}$ — полные поля в пространстве D_ξ , $\xi = 0, 1, i, s$ соответственно, $\mathbf{n}_{i,s}$ — единичные нормали к поверхностям $\partial D_{i,s}$, \mathbf{e}_z — нормаль в поверхности подложки, $k = \omega/c$, характеристики среды выбраны таким образом, что $\text{Im } \varepsilon_{0,1,s} = 0$, $\text{Im } \varepsilon_s \leq 0$, $\text{Im } \varepsilon_L = 0$. Предполагается, что временная зависимость выбрана в виде $\exp\{j\omega t\}$.

Конкретизируем остальные величины, входящие в постановку задачи (4). Поля $\{\mathbf{E}_\xi^0, \mathbf{H}_\xi^0\}$, $\xi = 0, 1$ представляют собой результат решения задачи отражения и преломления поля плоской волны $\{\mathbf{E}^0, \mathbf{H}^0\}$ на плоскости раздела Σ полупространств $D_{0,1}$. Поле $\{\mathbf{E}_\xi^s, \mathbf{H}_\xi^s\}$, $\xi = 0, 1$ есть рассеянное поле в каждом из полупространств, которое определяется, как $\mathbf{E}_\xi^s = \mathbf{E}_\xi - \mathbf{E}_\xi^0$, $\mathbf{H}_\xi^s = \mathbf{H}_\xi - \mathbf{H}_\xi^0$, $\xi = 0, 1$. В силу построения поля внешнего возбуждения и граничных условий на Σ рассеянное поле $\{\mathbf{E}_\xi^s, \mathbf{H}_\xi^s\}$, $\xi = 0, 1$ также должно удовлетворять условиям сопряжения для тангенциальных компонент на бесконечной границе Σ .

На поверхностях $\partial D_{i,s}$ в дополнение к классическим условиям сопряжения поставлены дополнительные условия для нормальных компонент полей, необходимые для однозначной разрешимости задачи. Эти условия физически соответствуют условиям обращения в нуль нормальной компоненты тока проводимости на границах раздела металл–диэлектрик $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J} = 0$, которые затем трансформируются в условия для нормальных компонент полей [14]. Причем последние отличаются от стандартных условий сопряжения для нормальных компонент смещения \mathbf{D} , которые являются следствием непрерывности тангенциальных компонент полей в классической постановке. Из формулировки задачи (4) непосредственно вытекает, что продольная компонента поля, во-первых, локализована строго внутри слоя, и во-вторых, не вносит вклад в магнитное поле \mathbf{H}_s , так как $\text{rot}(\text{grad}\Psi) \equiv 0$. Условия излучения задачи (4) сформулированы таким образом, чтобы обеспечить обращение в нуль потока энергии на бесконечности для однородной задачи (4) [22]. Мы будем полагать, что поставленная

граничная задача (4) имеет единственное классическое решение. Параметры ξ и ε_L , относящиеся к продольному полю \mathbf{E}_s^L , определяются следующим образом:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_L &= \varepsilon_s - \omega_p^2 / (j\gamma\omega - \omega^2), \\
\xi^2 &= \varepsilon_s (\beta^2 + D(\gamma + j\omega)) / (\omega^2 - j\gamma\omega).
\end{aligned}$$

Здесь ω_p — плазменная частота металла, γ — коэффициент затухания, β — гидродинамическая скорость в плазме, связанная со скоростью Ферми v_F соотношением $\beta^2 = 3/5 v_F^2$, D — коэффициент диффузии электронов [12].

Метод дискретных источников с учетом модели ОНО

Будем строить приближенное решение задачи (4), руководствуясь схемой [17]. Ограничимся случаем P -поляризации, поскольку именно она реализует наибольшую амплитуду плазмонного резонанса [23]. Так как частица целиком располагается в верхнем полупространстве D_0 , то суммарное поле падающей и отраженной волн $\{\mathbf{E}_0^0, \mathbf{H}_0^0\}$ приобретает вид

$$\mathbf{E}_0^0 = \mathbf{E}_0^- + \mathbf{R}_p \cdot \mathbf{E}_0^+; \quad \mathbf{H}_0^0 = \mathbf{H}_0^- + \mathbf{R}_p \cdot \mathbf{H}_0^+. \quad (5)$$

Здесь $\{\mathbf{E}_0^-, \mathbf{H}_0^-\} = \mathbf{E}^0 \mathbf{H}^0$, $\mathbf{E}_0^\pm = \mathbf{e}_0^\pm \psi_0^\pm$; $\mathbf{H}_0^\pm = -\mathbf{e}_y n_0 \psi_0^\pm$, $n_0 = \sqrt{\varepsilon_0}$, R_p — коэффициент отражения Френеля [24],

$$\psi_0^\pm = \exp\{-jk_0(x \sin \theta_0 \pm z \cos \theta_0)\},$$

$$\mathbf{e}_0^\pm = (\mp \mathbf{e}_x \cos \theta_0 + \mathbf{e}_z \sin \theta_0),$$

где $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ — единичные векторы декартовой системы координат.

Построим приближенное решение задачи (4) для рассеянного поля в D_0 с учетом осевой симметрии и поляризации, удовлетворяя квазиклассической системе уравнений Максвелла во всех областях постоянства параметров среды, условиям излучения и условиям сопряжения для полей на Σ . В основу представления для рассеянного поля положим фурье-компоненты тензора Грина полупространства, которые могут быть записаны в виде интегральных представлений Вейля–Зоммерфельда [17]:

$$\begin{aligned}
G_m^{e,h}(\eta, z_n) &= \int_0^\infty J_m(\lambda \rho) v_{11}^{e,h}(\lambda, z, z_n) \lambda^{1+m} d\lambda, \\
g_m^{(e,h)}(\eta, z_n) &= \int_0^\infty J_m(\lambda, \rho) v_{31}^{e,h}(\lambda, z, z_n) \lambda^{1+m} d\lambda.
\end{aligned} \quad (6)$$

Здесь $J_m(\cdot)$ — цилиндрическая функция Бесселя, точка $\eta = (\rho, z)$ располагается в полуплоскости $\varphi = \text{const}$, а точки локализации мультиполей распределены вдоль оси симметрии $z_n \in OZ$ строго внутри $D_i \cup D_s$. Спектральные функции электрического и магнитного типов $v_{11}^{e,h}$,

$v_{31}^{e,h}$ обеспечивают выполнение условий сопряжения на границе интерфейса $z = 0$. В данном случае для них справедливы следующие выражения:

$$v_{11}^{e,h}(\lambda, z, z_n) = \frac{\exp\{-\eta_0|z - z_n|\}}{\eta_0} + A_{11}^{e,h}(\lambda) \exp\{-\eta_0(z + z_n)\}, \quad z_n > 0, \quad z \geq 0;$$

$$v_{31}^{e,h}(\lambda, z, z_n) = A_{31}^{e,h}(\lambda) \exp\{-\eta_0(z + z_n)\}, \quad z_n > 0, \quad z \geq 0.$$

Спектральные коэффициенты A, B определяются из одномерной задачи с условиями сопряжения при $z = 0$, откуда легко получается, что

$$A_{11}^{e,h}(\lambda) = \frac{\chi_0^{e,h} - \chi_1^{e,h}}{\chi_0^{e,h} + \chi_1^{e,h}} \frac{1}{\eta_0}, \quad A_{31}^{e,h}(\lambda) = \frac{2\delta}{(\chi_0^e + \chi_1^e)(\chi_0^h + \chi_1^h)},$$

где $\eta_\xi = \sqrt{\lambda^2 - k_\xi^2}$, $\chi_\xi^e = \eta_\xi$, $\chi_\xi^h = \eta_\xi/\varepsilon_\xi$, $\delta = 1/\varepsilon_0 - 1/\varepsilon_1$, $\xi = 0, 1$.

Для построения приближенного решения для рассеянного поля в пространстве D_0 используются векторные потенциалы, которые в цилиндрической системе координат могут быть записаны как

$$\mathbf{A}_{mn}^{(e)0} = \{G_m^e(\eta, z_n^e) \cos(m+1)\varphi; -G_m^e(\eta, z_n^e) \sin(m+1)\varphi; -g_m^e(\eta, z_n^e) \cos(m+1)\varphi\},$$

$$\mathbf{A}_{mn}^{(h)0} = \{G_m^h(\eta, z_n^e) \sin(m+1)\varphi; G_m^h(\eta, z_n^e) \cos(m+1)\varphi; -g_{m+1}^h(\eta, z_n^e) \sin(m+1)\varphi\},$$

$$\mathbf{A}_{0n}^{(e)0} = \{0; 0; G_0^h(\eta, z_n^e)\}. \quad (7)$$

Для построения полей внутри областей $D_{i,s}$ будут использоваться следующие потенциалы:

$$\mathbf{A}_{mn}^{(e)v} = \{Y_m^v(\eta, z_n^v) \cos(m+1)\varphi; -Y_m^v(\eta, z_n^v) \sin(m+1)\varphi; 0\}, \quad v = i, s \pm;$$

$$\mathbf{A}_{mn}^{(h)v} = \{Y_m^v(\eta, z_n^v) \sin(m+1)\varphi; -Y_m^v(\eta, z_n^v) \cos(m+1)\varphi; 0\}, \quad \mathbf{A}_n^{(e)v} = \{0; 0; Y_0^v(\eta, z_n^v)\}. \quad (8)$$

Здесь $Y_m^i(\eta, z_n^i) = j_m(k_i r_{\eta z_n^i})(\rho/r_{\eta z_n^i})^m$, $j_m(\cdot)$ — сферическая функция Бесселя, $Y_m^{s\pm}(\eta, z_n^s) = h_m^{(2,1)}(k_s r_{\eta z_n^s}) \times (\rho/r_{\eta z_n^s})^m$, $h_m^{(2,1)}(\cdot)$ — сферическая функция Ханкеля, соответствующие „уходящим“ и „приходящим“ волнам, $r_{\eta z_n}^2 = \rho^2 + (z - z_n)^2$, $\eta = (\rho, z)$, $k_{is} = k\sqrt{\varepsilon_{i,s}}$, $z_n^{i,s}$ — координаты дискретных источников (ДИ). Следует отметить, что функции, положенные в основу векторных потенциалов (7), (8), удовлетворяют уравнению Гельмгольца (2).

Для случая P -поляризации продольное поле строится на основе следующих скалярных потенциалов [18]:

$$\Psi_{mn}^{s\pm}(M) = h_{m+1}^{(2,1)}(k_L R_{\eta z_n^s}) P_{m+1}^{m+1}(\cos \theta_{z_n^s}) \cos(m+1)\varphi,$$

$$\Psi_n^{s\pm}(M) = h_0^{(2,1)}(k_L R_{\xi z_n^s}),$$

которые удовлетворяют уравнению Гельмгольца (3). Тогда приближенное решение для полного поля внутри частицы и рассеянного поля в пространстве D_0 , соответствующее P -поляризации, принимает следующий вид:

$$\mathbf{E}_v^{TN} = \sum_{m=0}^M \sum_{n=1}^{N_v^m} \left\{ p_{mn}^v \frac{j}{k\varepsilon_v} \text{rot rot } \mathbf{A}_{mn}^{(e)v} + q_{mn}^v \frac{1}{\varepsilon_v} \text{rot } \mathbf{A}_{mn}^{(h)v} \right\} + \sum_{n=1}^{N_v^0} r_n^v \frac{j}{k\varepsilon_v} \text{rot rot } \mathbf{A}_n^{(e)v};$$

$$\mathbf{E}_{s\pm}^{LN} = \sum_{m=0}^M \sum_{n=1}^{N_s^m} \bar{p}_{mm}^{s\pm} \text{grad } \Psi_{mm}^{s\pm} + \sum_{n=1}^{N_s^m} \bar{r}_n^{s\pm} \text{grad } \Psi_n^{s\pm}; \quad \mathbf{H}_v^N = \frac{j}{k} \text{rot } \mathbf{E}_v^N, \quad v = 0, i, s \pm. \quad (9)$$

Заметим, что внутри оболочки D_s электромагнитное поле строится как сумма „уходящих“ и „приходящих“ волн:

$$\mathbf{E}_s^N = \mathbf{E}_{s+}^{TN} + \mathbf{E}_{s-}^{TN} + \mathbf{E}_{s+}^{LN} + \mathbf{E}_{s-}^{LN}, \quad \text{div } \mathbf{E}_{s\pm}^{TN} = 0, \quad \text{rot } \mathbf{E}_{s\pm}^{LN} = 0.$$

Построенные поля (9) удовлетворяют системе уравнений Максвелла граничной задачи (4) и условиям сопряжения на бесконечной поверхности подложки Σ . А неизвестные амплитуды ДИ $\{p_{mn}^v, q_{mn}^v, r_n^v; \bar{p}_{mm}^{s\pm}, \bar{r}_n^{s\pm}\}$ определяются из условий сопряжения на поверхностях $\partial D_{i,s}$.

Численный алгоритм строится по схеме, изложенной в [17]. Используя обобщенный метод коллокаций [25], фурье-гармоники полей (9) и внешнего возбуждения сшиваются на образующих поверхностях вращения, а контроль погрешности решения осуществляется вычислением невязки в промежуточных точках. Подобный подход позволяет обеспечить устойчивость вычислительной схемы при увеличении числа точек коллокаций и ДИ. Здесь следует подчеркнуть, что основная трудность при реализации схемы с учетом ОНО заключается в существенном различии значений продольного и поперечного волновых чисел. Это отношение $|k_L/k_T|$ может доходить до двух порядков в области резонансных длин волн. Таким образом, внутри плазмонного металла оказываются два поля с совершенно различным поведением. Однако эти сложности в рамках численной схемы МДИ компенсируются выбором различного числа ДИ для представления продольного и поперечного полей.

Для вычисления характеристик рассеяния в дальней зоне нам понадобится диаграмма направленности рассеянного поля $\mathbf{F}(\theta, \varphi)$, которая определяется в верхнем полупространстве как

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r})/|\mathbf{E}^0(z=0)| = \frac{\exp\{-jk_0 r\}}{r} \mathbf{F}(\theta, \varphi) + O(1/r^2), \quad r \rightarrow \infty, \quad z > 0. \quad (10)$$

Тогда (θ, φ) -компоненты диаграммы на единичной полу-сфере для P поляризации принимают вид

$$F_{\theta}^P(\theta, \varphi) = jk_0 \sum_{m=0}^M \cos((m+1)\varphi)(j \sin \theta)^m \times \sum_{n=1}^{N_0^m} \{p_{nm}^0 [\bar{G}_n^e \cos \theta + jk_0 \bar{g}_n^e \sin^2 \theta] + q_{nm}^0 \bar{G}_n^h\} - j \frac{k_0}{\varepsilon_0} \sin \theta \sum_{n=1}^{N_0^0} r_n^0 \bar{G}_n^h,$$

$$F_{\varphi}^P(\theta, \varphi) = -jk_0 \sum_{m=0}^M \sin((m+1)\varphi)(j \sin \theta)^m \sum_{n=0}^{N_0^m} \{p_{nm}^0 \bar{G}_n^e + q_{nm}^0 [\bar{G}_n^h \cos \theta + jk_0 \bar{g}_n^h \sin^2 \theta]\}, \quad (11)$$

где соответствующие спектральные функции $\bar{G}_n^{e,h}$, \bar{g}_n^h могут быть представлены как

$$\bar{G}_n^{e,h} = \exp\{jk_0 z_n \cos \theta\} + A_{11}^{e,h}(k_0 \sin \theta) \times \exp\{-jk_0 \cos \theta\}, \quad z_n > 0;$$

$$\bar{g}_n^{e,h}(\theta) = jk_0 \cos \theta v_{31}^{e,h}(k_0 \sin \theta, z = 0, z_n).$$

Определив амплитуды ДИ для рассеянного поля, можно легко вычислить компоненты диаграммы направленности (10), (11) на единичной полусфере $\Omega^+ = \{0 \leq \theta \leq \pi/2; 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, а также поле (9) в непосредственной близости от слоистой частицы.

Численные результаты

Будем рассматривать слоистую сферическую частицу с фиксированным диаметром ядра $D = 15 \text{ nm}$, состоящем из SiO_2 с индексом рефракции $n_i = 1.46$ и золотой оболочкой, толщину которой обозначим как d . Пусть частица располагается на стеклянной подложке ВК7 с индексом рефракции $n_1 = 1.52$ в воде с индексом $n_0 = 1.33$. В расчетах частотная дисперсия золота учитывается в соответствии с экспериментальными результатами [26].

Нас будут интересовать как интенсивность рассеяния в дальней зоне:

$$\sigma_{sc}(\theta_0, \lambda) = \int_{\Omega^+} |F_{\theta}^P(\theta_0, \theta, \varphi)|^2 + |F_{\varphi}^P(\theta_0, \theta, \varphi)|^2 d\omega, \quad (12)$$

так и характеристики поля в непосредственной близости от внешней оболочки слоя ∂D_s . А именно коэффициент усиления интенсивности поля

$$E(\theta_0, \lambda) = \int_{\partial D_s} |\mathbf{E}_0^N + \mathbf{E}_0^0|^2 d\sigma / \int_{\partial D_s} |\mathbf{E}_0^0|^2 d\sigma. \quad (13)$$

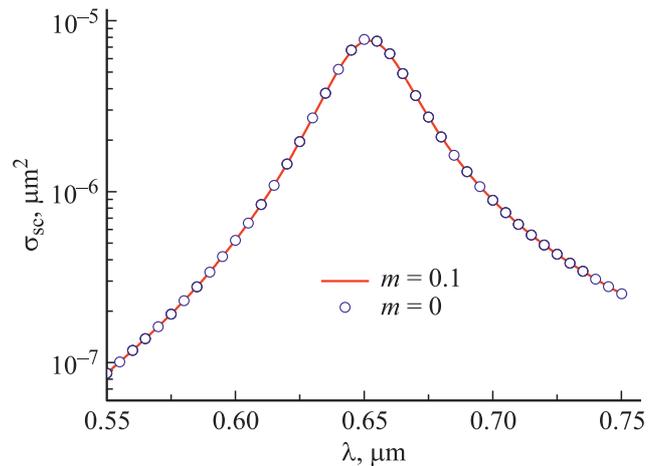


Рис. 1. Сечение рассеяния $\sigma_{sc}(\lambda)$ по формуле (12) в зависимости от длины волны λ , толщина слоя $d = 2 \text{ nm}$, угол падения волны $\theta_0 = 45^\circ$. Сплошная кривая $m = 0, 1$ — учитываются диполи и квадруполь, кружки $m = 0$ — только диполи.

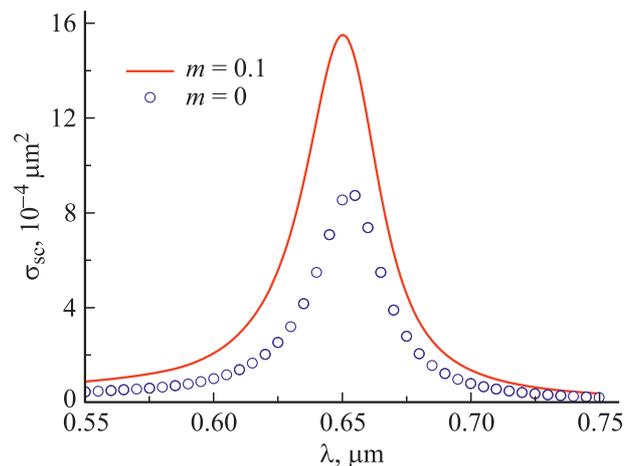


Рис. 2. То же, что и на рис. 1, но для сечения поглощения $\sigma_{abs}(\lambda)$ по формуле (14).

и сечение поглощения

$$\sigma_{abs}(\theta_0, \lambda) = -\text{Re} \int_{\partial D_s} (\mathbf{E}_0^N + \mathbf{E}_0^0) \times (\mathbf{H}_0^N + \mathbf{H}_0^0)^* d\sigma. \quad (14)$$

Размерности интенсивности и сечения поглощения равны μm^2 .

В наноплазмонике зачастую используют квазистационарное или дипольное приближения для анализа оптических свойств наночастиц [27]. Результаты, представленные на рис. 1, 2, призваны подчеркнуть важность строгого учета взаимодействия частицы с подложкой, а также неприменимость использования дипольного приближения в этом случае. А именно подчеркнуть различие в точности аппроксимации ближнего и дальнего полей. Для этого выберем толщину слоя $d = 2 \text{ nm}$ и наклонный угол падения волны $\theta_0 = 45^\circ$. Все приведенные

результаты соответствуют локальному случаю. В данном случае для аппроксимации поля плоской волны на ∂D_s с погрешностью $\approx 0.2\%$ требуется учет фурье-гармоник с азимутальными числами $m = 0, 1$. При этом $m = 0$ включает в себя вертикальные и горизонтальные диполи, а $m = 0, 1$ еще и горизонтальные квадруполь, распределенные вдоль оси вращения. На рис. 1 приведены результаты сравнения $\sigma_{sc}(\lambda)$ для $m = 0$ и $m = 0, 1$. Легко видеть, что эти результаты совпадают с графической точностью. На рис. 2 приведены результаты сравнения для $\sigma_{abs}(\lambda)$, которые различаются почти в два раза. Это сравнение подчеркивает необходимость использования строгих подходов при анализе характеристик ближнего поля.

Перейдем к анализу влияния нелокальности на коэффициент усиления (13) и сечение поглощения (14). Для золота соответствующие квантовые параметры, необходимые для вычисления нелокальных величин ϵ_L и k_L , выбраны равными [14]:

$$\hbar\omega_p = 8.99 \text{ eV}, \quad \hbar\gamma = 0.025 \text{ eV},$$

$$v_F = 1.39 \cdot 10^{12} \text{ } \mu\text{m/s}, \quad D = 9.62 \cdot 10^8 \text{ } \mu\text{m}^2/\text{s}.$$

Задавая длину волны внешнего возбуждения λ , вычисляя соответствующее значение ω , легко определить значения нелокальных параметров ϵ_L и k_L .

На рис. 3, 4 приведены сравнительные результаты расчета коэффициента усиления и сечения поглощения для пленки толщиной $d = 2$ и 3 nm в зависимости от угла падения плоской волны θ_0 при фиксированных длинах волн. Видно, что обе величины монотонно возрастают при увеличении угла падения. В то же время учет ЭН приводит к существенному снижению величин максимумов. Например, для $d = 2 \text{ nm}$ у σ_{abs} оно составляет 33%, а у E — почти 50%.

На рис. 5, 6 приведены те же величины, но в частотной области при фиксированном угле падения $\theta_0 = 45^\circ$. Как

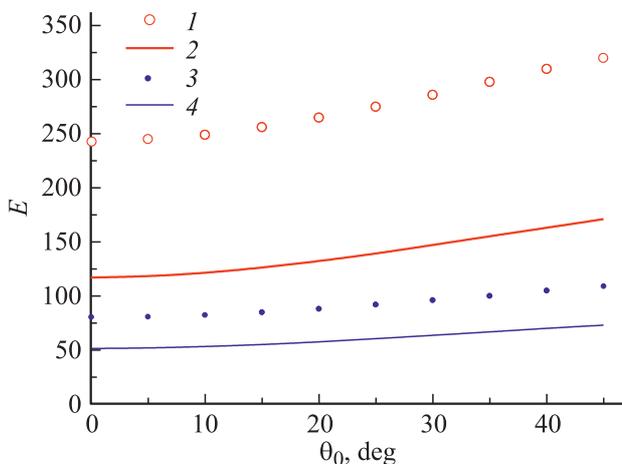


Рис. 3. Коэффициент усиления E по формуле (13) в зависимости от угла падения волны θ_0 : $d = 2 \text{ nm}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$, кружки 1 — локальный случай, сплошная кривая 2 — с учетом ЭН; $d = 3 \text{ nm}$, $\lambda = 600 \text{ nm}$, точки 3 — локальный случай, сплошная кривая 4 — с учетом ЭН.

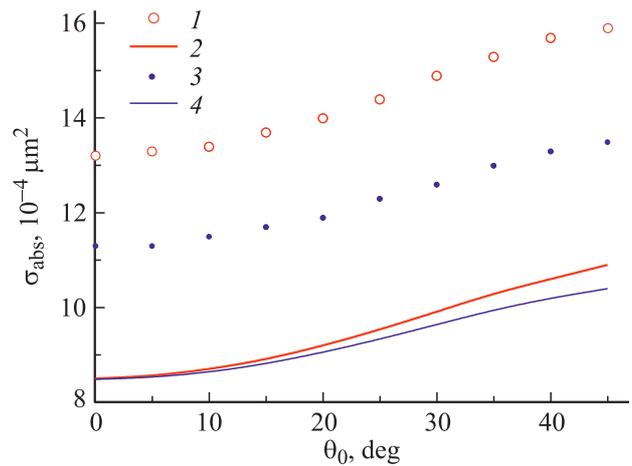


Рис. 4. То же, что и на рис. 3, но для сечения поглощения σ_{abs} по формуле (14).

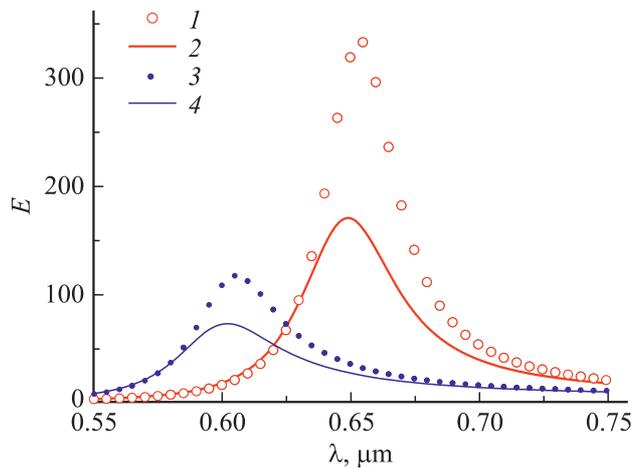


Рис. 5. Коэффициент усиления E по формуле (13) в зависимости от длины волны λ , угол падения $\theta_0 = 45^\circ$: $d = 2 \text{ nm}$, кружки 1 — локальный случай, сплошная кривая 2 — с учетом ЭН; $d = 3 \text{ nm}$, точки 3 — локальный случай, сплошная кривая 4 — с учетом ЭН.

и раньше, заметно, что учет ЭН приводит к снижению их значений. Причем сильнее это влияние проявляется для коэффициента усиления. На рисунках также заметен небольшой сдвиг плазмонного резонанса в область коротких длин волн.

Рис. 7, 8 посвящены случаю возбуждения слоистой частицы неизлучающими волнами, когда плоская волн распространяется из призмы в верхнее полупространство, заполненное водой. Неизлучающие волны широко используются в современной оптике [6, 7, 17]. В данном случае область неизлучающих волн располагается перед углом, равным $\theta_c = 118.7^\circ$. Мы выбрали угол падения волны $\theta_0 = 116.7^\circ$. В этом случае удастся увеличить значения E почти на 30%, а сечение поглощения — более чем в 4 раза по сравнению со случаем падения волны сверху (рис. 5, 6). При этом снова учет ЭН приводит к

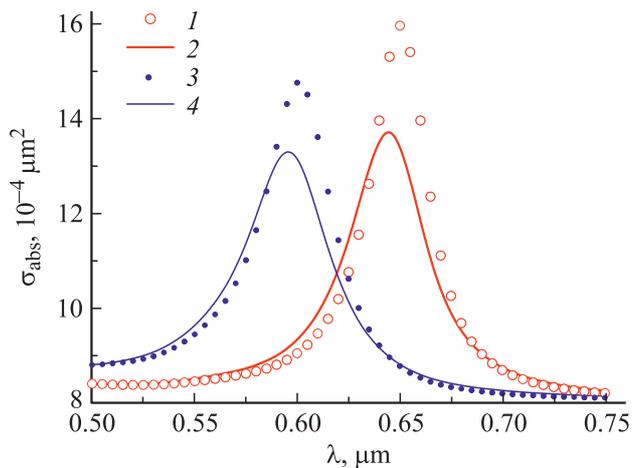


Рис. 6. То же, что и на рис. 5, но для сечения поглощения σ_{abs} по формуле (14).

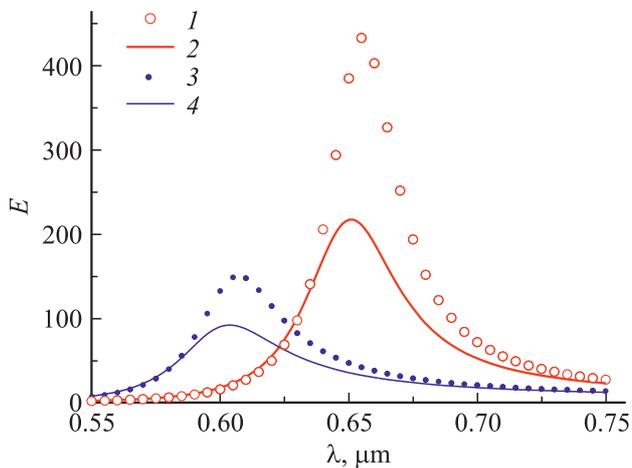


Рис. 7. Коэффициент усиления E по формуле (13) в зависимости от длины волны λ , угол падения $\theta_0 = 116.7^\circ$ — область неизлучающих волн: $d = 2$ nm, кружки 1 — локальный случай, сплошная кривая 2 — с учетом ЭН; $d = 3$ nm, точки 3 — локальный случай, сплошная кривая 4 — с учетом ЭН.

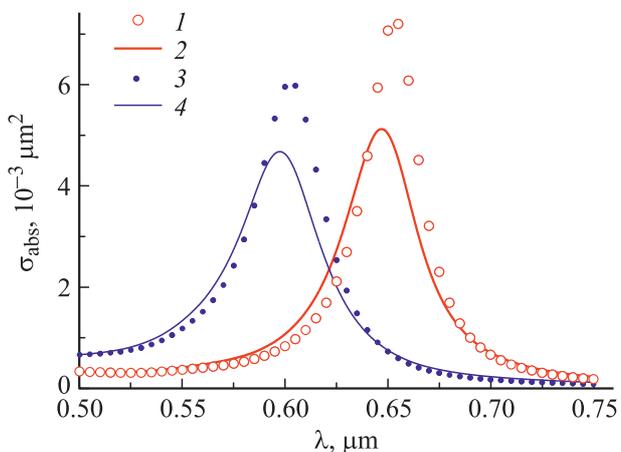


Рис. 8. То же, что на рис. 7, но для сечения поглощения σ_{abs} .

снижению максимумов величин и небольшому сдвигу в коротковолновую область.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-01-00558).

Список литературы

- [1] Xu D., Xiong X., Wu L. et al. // *Adv. Opt. Photon.* 2018. V. 10. N 4. P. 703. doi 10.1364/AOP.10.000703
- [2] Zhang S., Geryak R., Geldmeier J., Kim S., Tsukruk V.V. // *Chem. Rev.* 2017. V. 117. P. 12942. doi 10.1021/acs.chemrev.7b00088
- [3] Kalambate P.K., Dhanjai Huang Z., Li Y. et al. // *Trends Analyt. Chem.* 2019. V. 115. P.1 47–161. doi 10.1016/j.trac.2019.04.002
- [4] Evlyukin A., Nerkararyan K.V., Bozhevolnyi S.I. // *Opt. Express.* 2019. V. 27. P. 17474. doi 10.1364/OE.27.017474
- [5] Балькин В.И. // *УФН.* 2018. Т. 188. № 9. С. 935. doi 10.3367/UFNr.2017.09.038206
- [6] Sidorenko I., Nizamov Sh., Hergenr?de R., Zybin A. et al. // *Microchim. Acta.* 2016. V. 183. P. 101. doi 10.1007/s00604-015-1599-0
- [7] Aşar D., Ertürk H., Mengüç M.P. // *Mater. Res. Express.* 2019. V. 6. P. 065006. doi 10.1088/2053-1591/ab07fd
- [8] Barbry M., Koval P., Marchesin F., Esteban R. et al. // *Nano Lett.* 2015. V. 15. P. 3410. doi 10.1021/acs.nanolett.5b00759
- [9] David C., García de Abajo F.J. // *J. Phys. Chem. C.* 2011. V. 115. P. 19470. doi 10.1021/jp204261u
- [10] Ciraci C., Pendry J.B., Smith D.R. // *Chem. Phys. Chem.* 2013. V. 14. P. 1109. doi 10.1002/cphc.201200992
- [11] Derkachova A., Kolwas K., Demchenko I. // *Plasmonics.* 2016. V. 11. P. 941. doi 10.1007/s11468-015-0128-7
- [12] Mortensen N.A., Raza S., Wubs M., Søndergaard T., Bozhevolnyi S.I. // *Nature Commun.* 2014. V. 5. P. 3809. doi 10.1038/ncomms4809
- [13] Tserkezi C., Stefanou N., Wubs M., Mortensen N.A. // *Nanoscale.* 2016. V. 8. P. 17532. doi 10.1039/C6NR06393D
- [14] Wubs M., Mortensen A. // *Quantum Plasmonics* / Ed. by Bozhevolnyi S.I. et al. Springer, Switzerland. 2017. P. 279–302. doi 10.1007/978-3-319-45820-5_12
- [15] Eremina E., Eremin Y., Wriedt T. // *J. Mod. Opt.* 2011. V. 58. P. 384. doi 10.1080/09500340.2010.515751
- [16] Doicu A., Eremin Yu., Wriedt T. *Acoustic and Electromagnetic Scattering Analysis Using Discrete Sources.* Academic Press, San Diego, 2000.
- [17] Гришина Н.В., Еремин Ю.А., Свешников А.Г. // *Опт. и спектр.* 2013. Т. 115. № 1. С. 133–139. doi 10.7868/S0030403413070076; Grishina N.V., Eremin Yu.A., Sveshnikov A.G. // *Opt. Spectrosc.* 2013. V. 115. № 1. С. 136. doi 10.1134/S0030400X13070072
- [18] Еремин Ю.А., Свешников А.Г. // *ЖВМиМФ.* 2019. Т. 59. № 12. С. 2175. doi 10.1134/S0044466919100065; Eremin Yu.A., Sveshnikov A.G. // *Comput. Math. Math. Phys.* 2019. V. 59. N 12. P. 2164. doi 10.1134/S0965542519100063
- [19] Eremin Yu., Doicu A., Wriedt T. // *J. Quant. Spectr. Rad. Trans.* 2019. V. 235. P. 300. doi 10.1016/j.jqsrt.2019.07.012

- [20] *Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П.* Физическая кинетика. М.: Наука, 1978. С. 167.
- [21] *Doicu A., Eremiu Yu., Wriedt T.* // J. Quant. Spectr. Rad. Trans. 2020. V. 242. P. 106756. doi 10.1016/j.jqsrt.2019.106756
- [22] *Jerez-Hanckes C., Nédélec J.C.* // Commun. Comput. Phys. 2012. V. 11. N 2. P. 629. doi 10.4208/cicp.231209.150910s
- [23] *Гришина Н.В., Еремин Ю.А., Свешников А.Г.* // Опт. и спектр. 2012. Т. 113. № 4. С. 484; *Grishina N.V., Eremiu Yu.A., Sveshnikov A.G.* // Opt. Spectrosc. 2012. V. 113. N 4. P. 440. doi 10.1134/S0030400X12100049
- [24] *Борн М., Вольф Э.* Основы оптики. М.: Наука, 1973. 713 с. *Born M., Wolf E.* Principles of Optics. N.Y.: Pergamon Press, 1964.
- [25] *Бахвалов Н.С.* Численные методы. М.: Наука, 1975. 632 с.
- [26] *Johnson P.B., Christy R.W.* // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. P. 4370.
- [27] *Khlebtsov N.G., Khlebtsov B.N.* // J. Quant. Spectr. Rad. Trans. 2017. V. 190. P. 89. doi 10.1016/j.jqsrt.2017.01.027